(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-247932 (P2000-247932A)

(43)公開日 平成12年9月12日(2000.9.12)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号		F I			7	7]-ド(参考)
C 0 7 C 211,	/54		C 0	7 C 211/54			2H068
211,	/58		٠	211/58			3 K 0 0 7
C 0 7 D 209	/86		C 0	7 D 209/86			4 C 0 3 6
271,	/10			271/10			4 C 0 5 6
279,	/22			279/22			4 C 0 6 5
		審查請求	未請求	請求項の数8	OL	(全 35 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願平11-52513

(22)出願日 平成11年3月1日(1999.3.1)

(71)出顧人 000006079

ミノルタ株式会社

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号

大阪国際ビル

(72)発明者 藤野 泰光

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号

大阪国際ピル ミノルタ株式会社内

(72)発明者 植田 秀昭

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号

大阪国際ビル ミノルタ株式会社内

(74)代理人 100062144

弁理士 青山 葆 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 新規アミノ化合物とその製造方法、および用途

(57)【要約】

【課題】 電子写真感光体や有機エレクトロルミネッセンス素子に利用可能な新規アミノ化合物を提供すること

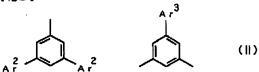
【解決手段】 下記一般式(I)で表わされるアミノ化合物とその製法、および用途;

【化1】

$$A \leftarrow A r^{1} - N \left(\frac{R^{1}}{R^{2}} \right)_{n} \tag{1}$$

(式中、Aは下記一般式(II)

【化2】



 $(Ar^2, Ar^3$ は置換もしくは無置換のアリール基を表わす)で表される基を表わし; Ar^1 は置換もしくは無

置換のアリーレン基を表わす; nは1または2の整数を表わす; R^1 、 R^2 はそれぞれ独立して、アルキル基、アラルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基を表わし、 R^1 と R^2 は一体となって環を形成してもよい)。

(2)

【特許請求の範囲】

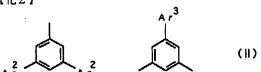
【請求項1】 下記一般式(I)で表されるアミノ化合物:

【化1】

$$A \leftarrow A r^{1} - N \begin{pmatrix} R^{1} \\ R^{2} \end{pmatrix}_{n} \qquad (1)$$

(式中、Aは下記一般式(II);

【化2】



+ $- Ar^4 - N < R^3$ (III)

(式中、A r⁴ は置換もしくは無置換のアリーレン基を表わす; R^3 、 R^4 はそれぞれ独立して、アルキル基、アラルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基を表わし、 R^3 と R^4 は一体となって環を形成してもよい)。

【請求項3】 下記一般式(IV)で表わされるハロゲン化合物:

【化4】

$$A \leftarrow A r^1 - X$$

(式中、A、Ar¹、nは請求項1に記載のものと同意 義;Xはハロゲン原子を表わす)と下記一般式(V)で 表されるアミノ化合物;

【化5】



(式中、R¹、R²は請求項1または請求項2に記載のものと同意義)を反応させることを特徴とする、下記一般式(I)で表わされるアミノ化合物の製造方法:

【化6】

$$A \leftarrow Ar^{1} - N \begin{pmatrix} R^{1} \\ R^{2} \end{pmatrix}_{n} \qquad (1)$$

 (式中、A、Ar¹、n、R¹、R²は前記と同意義)。

 【請求項4】 (a)下記一般式(VI)で表わされるホルミル化アリール化合物;

【化7】

* (Ar²、Ar³は置換もしくは無置換のアリール基を表わす)で表される基を表わし; Ar¹は置換もしくは無置換のアリーレン基を表わす; nは1または2の整数を表わす; R¹、R²はそれぞれ独立して、アルキル基、アラルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基を表わし、R¹とR²は一

体となって環を形成してもよい)。 【請求項2】 上記一般式(I)において、 R^1 、 R^2 の いずれか一方、あるいは両方が、下記一般式(I I I I

10 で表わされる基である請求項1 に記載のアミノ化合物: 【化3】

 $20 * x - Ar^5 - C - H$

(式中、Ar⁵は置換もしくは無置換のアリーレン基を表わし、Xはハロゲン原子を表わす)と下記一般式(IX)で表わされるアセチル化アリール化合物;

【化8】

$$Ar^{8} - C - CH_{3} \qquad (IX)$$

(式中、Ar⁸は置換もしくは無置換のアリール基を表わす)を反応させて下記一般式(X)で表されるピリリウム塩を得る工程;

【化9】

*

(b)前記ピリリウム塩を無水酢酸中、酢酸ナトリウム存在下に加熱処理し、下記一般式(XI)で表わされるハロゲン化1,3.5-トリアリールベンゼン化合物; 【化10】

3

(式中、 Ar^5 、 Ar^8 は前記と同意義)に転化させる工程;および(c)得られた前記ハロゲン化1,3,5-トリアリールベンゼン化合物と下記一般式(V)で表されるアミノ化合物;

【化11】



(式中、R¹、R²は請求項1または請求項2に記載のものと同意義)を反応させる工程から成る、下記一般式で表されるアミノ化合物の製造方法:

(式中、Ar⁵、Ar⁸、R¹、R²は前記と同意義)。 【請求項5】 (a)下記一般式(VII)で表わされるホルミル化アリール化合物;

(XIV)

【化13】

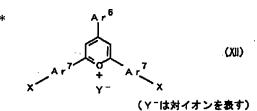
(式中、Ar⁶は置換もしくは無置換のアリール基を表わす)と下記一般式(VIII)で表わされるアセチル化アリール化合物;

【化14】

$$x \longrightarrow Ar^7 \longrightarrow C \longrightarrow CH_3$$
 (Wii)

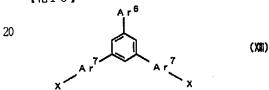
(式中、Ar7は置換もしくは無置換のアリーレン基を表わし、Xはハロゲン原子を表わす)を反応させて下記一般式(XII)で表わされるピリリウム塩を得る工程;

【化15】



(b)前記ピリリウム塩を無水酢酸中、酢酸ナトリウム 存在下に加熱処理し、下記一般式(XIII)で表わされるハロゲン化1,3,5トリアリールベンゼン化合物:

【化16】



(式中、 Ar^6 、 Ar^7 は上記と同意儀) に転化させる工程; および (c) 得られた前記ハロゲン化1, 3, 5トリアリールベンゼン化合物と下記一般式 (V) で表わされるアミノ化合物;

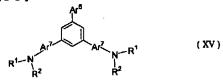
【化17】

30



(式中、R¹、R²は請求項1または請求項2に記載のものと同意義)を反応させる工程から成る、下記一般式で表されるアミノ化合物の製造方法:

【化18】



(式中、A r⁶、A r⁷、R¹、R²は上記と同意義)。 【請求項6】 請求項1記載のアミノ化合物からなる正 孔輸送材料。

【請求項7】 一対の電極間に発光層または発光層を含む複数の有機化合物薄膜を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子において、少なくとも一層が、請求項1記50 載のアミノ化合物を含有する層であることを特徴とする

有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項8】 導電性支持体上に、電荷発生材料および 電荷輸送材料を使用してなる電子写真感光体において、 電荷輸送材料が請求項6記載の正孔輸送材料であること を特徴とする電子写真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なアミノ化合物とその製造方法、およびその用途に関する。本発明のアミノ化合物は発光材料、有機光導電材料等に使用する 10 ことができ、より具体的には、面光源や表示に使用される有機エレクトロルミネッセンス素子や電子写真感光体に有用である。

[0002]

【従来の技術】感光体や電荷輸送材料として開発されている有機光導電性材料は、低コスト、加工性が多様であり、無公害性などの多くの利点があり、多くの化合物が提案されている。

【0003】例えば、オキサジアゾール化合物、ヒドラ ゾン化合物、ピラゾリン化合物、オキサゾール化合物、 アリールアミン化合物、ベンジジン化合物、スチルベン 化合物、ブタジエン化合物などの有機光導電材料が提案 されている。

【0004】電荷輸送材料を利用した技術の一つとして、電子写真感光体が挙げられる。電子写真方式は、カールソンにより発明された画像形成法の一つである。この方式は、コロナ放電により感光体を帯電した後、像露光して感光体上に静電潜像を形成させ、該静電潜像上にトナーを付着させて現像し、得られたトナー像を紙に転写することからなる。

【0005】このような電子写真方式における感光体に要求される基本的な特性としては、暗所において適当な電位が保持されること、暗所における電荷の散逸が少ないこと、光照射により速やかに電荷を散逸することなどが挙げられる。従来の電子写真感光体は、セレン、セレン合金、酸化亜鉛、硫化カドミウムなどの無機光導電体が使用されてきた。これら無機光導電体は、耐久性が高く、耐刷枚数が多いなどの利点を有しているが、製造コストが高い、加工性に劣る、毒性を有するなどの問題点が指摘されている。

【0006】これらの欠点を克服するため、有機光導電体の開発が行われているが、従来までの有機光導電体を電荷輸送材料に用いた電子写真感光体は、帯電性、感度、および残留電位などの電子写真特性が必ずしも満足されているものとは言えないのが現状であり、優れた電荷輸送能力を有し、耐久性のある電荷輸送材料の開発が望まれていた。

【0007】電荷輸送材料を利用した技術として、有機 エレクトロルミネッセンス素子が挙げられる。有機化合 物を使用したエレクトロルミネッセンス素子は、固体発 50

光型の安価な大画面フルカラー表示素子としての用途が 有望視され、数多くの研究が行われている。

【0008】一般に有機エレクトロルミネッセンス素子は、発光層及び、該発光層を挟んだ一対の対向電極から構成されている。発光は、両電極間に電界が印加されると、陰極から電子が注入され、陽極から正孔が注入される。さらに、この電子と正孔が発光層において再結合し、エネルギー準位が伝導帯から価電子帯に戻る際にエネルギーを光として放出する現象である。

【0009】従来の有機エレクトロルミネッセンス素子は、無機エレクトロルミネッセンス素子に比べて駆動電圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。また、特性劣化も著しく実用化には至らなかった。近年、10V以下の低電圧で発光する高い蛍光量子効率を持った有機化合物を含有した薄膜を積層した有機エレクトロルミネッセンス素子が報告され、関心を集めている(アプライド・フィジックス・レターズ、51巻、913頁、1987年参照)。

【0010】この方法は、金属キレート錯体を発光体層、アミン系化合物を正孔注入層に使用して、高輝度の緑色発光を得ており、6~7Vの直流電圧で輝度は数100cd/m²、最大発光効率は1.51m/Wを達成して、実用領域に近い性能を持っている。

【0011】しかしながら、現在までの有機エレクトロルミネッセンス素子は、構成の改善により発光効率は改良されてきてはいるが、未だ充分な発光輝度を有していない。また、繰り返し使用時での安定性に劣るという大きな問題点を持っている。従って、より大きな発光輝度を持ち、繰り返し使用時での安定性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子の開発のために、優れた電荷輸送能を有し、耐久性のある電荷輸送材料の開発が望まれている。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は以上のような 事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところ は、耐久性のある電荷輸送材料や発光材料として有用 な、新規アミノ化合物、その製造法、およびその用途を 提供することにある。

[0013]

0 【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、下 記一般式(I)で表わされる新規なアミノ化合物を提供 するものである。

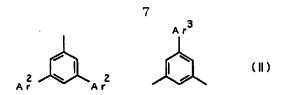
【化19】

$$A \leftarrow Ar^{1} - N \left(\frac{R^{1}}{R^{2}} \right)_{n} \tag{1}$$

【0014】上記一般式(I)中、Aは下記一般式(II);

(化20】





で表される基を示す。一般式(II)中、Ar2、Ar3 は、それぞれ独立して、置換もしくは無置換のアリール 基を表わす。アリール基としてはフェニル基、ビフェニ ル基、ターフェニル基、ナフチル基等を表わし、好まし てはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピ ル基などのアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロ ポキシ基などのアルコキシ基、ベンジル基などのアラル キル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基などの アリール基、チエニル基、フリル基、ピリジル基などの 複素環基を有していてもよい。好ましい置換基はアルキ ル基またはアルコキシ基である。特にメチル基、メトキ シ基が好ましい。

【0015】一般式(I)中、Ariは置換もしくは無 置換のアリーレン基を表わす。アリーレン基としては、 フェニレン基、ビフェニレン基、ターフェニレン基、ナ フチレン基等である。好ましくはフェニレン基、ビフェ ニレン基などである。置換基としては、メチル基、エチ ル基、n-プロピル基、イソプロピル基などのアルキル* *基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基などのアル コキシ基、ベンジル基などのアラルキル基、フェニル 基、ビフェニル基、ナフチル基などのアリール基、チエ ニル基、フリル基、ピリジル基などである。好ましくは 無置換のアリーレン基である。

【0016】一般式(I)中、nは1または2の整数を 表す。すなわち一般式(II)中のベンゼン環に結合す るアリレーン基Ar1の結合位置は、ベンゼン環の3 位、または3,5位である。nが2の場合、一般式(I くはフェニル基、ビフェニル基などである。置換基とし 10 I)中のベンゼン環に結合する基は同一であっても異な っていてもよい。

> 【0017】一般式 (I) 中、R¹、R²はそれぞれ独立 して、アルキル基、アラルキル基、置換もしくは無置換 のアリール基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基を 表わし、R1とR2は一体となって環を形成してもよい。 アルキル基としてはメチル基、エチル基、n-プロピル 基、イソプロピル基等、アラルキル基としてはベンジル 基等、アリール基としてはフェニル基、ピフェニル基、 ナフチル基等、芳香族複素環基としてはチエニル基、フ 20 リル基、ピリジル基等が例示できる。R1とR2が一体と なって環を形成する場合、R1とR2が結合する窒素原子 と共に環、例えば;

【化21】











を形成してもよい。好ましくはフェニル、ピフェニル、 ナフチル等、またはR1とR2が一体となって形成した 環;

【化22】



【0018】R1とR2が置換基を有して良い場合は、そ※40

【0019】特に、R1とR2が置換基を有するアリール の場合、R1とR2のいずれか一方、あるいは両方が下記 一般式(III);

【化23】

$$-Ar^{4}-N < \frac{R^{3}}{R^{4}}$$
 (III)

で表されるアミノ置換アリールであることが好ましい。 【0020】一般式(III)中、Ar⁴はフェニレン 基、ビフェニレン基、ターフェニレン基、ナフチレン基 等のアリーレン基を表し、好ましくはフェニレン基、ビ フェニレン基などである。これらの基はメチル基、エチ・ ル基、n-プロピル基、イソプロピル基などのアルキル★50 【0021】一般式(III)中、R3およびR4はそれ

★基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基などのアル コキシ基、ベンジル基などのアラルキル基、フェニル 基、ビフェニル基、ナフチル基などのアリール基、チエ ニル基、フリル基、ピリジル基などの複素環基を置換基 として有していてもよいが、無置換の方が好ましい。

ぞれ独立して、アルキル基、アラルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基を表わし、R3とR4は一体となって環を形成してもよい。アルキル基としてはメチル基、エチル基、n-プロビル基、イソプロビル基等、アラルキル基としてはベンジル基等、アリール基としてはフェニル基、ビフェ*

*ニル基、ナフチル基等、芳香族複素環基としてはチエニル基、フリル基、ピリジル基等が例示できる。R³とR⁴が一体となって環を形成する場合、R³とR⁴が結合する 窒素原子と共に環、例えば;

【化24】











を形成してもよい。好ましくは、フェニル、ピフェニル、ナフチル等、または R^1 と R^2 が一体となって形成した環;

【化25】



である。

【0022】R³とR⁴が置換基を有して良い場合は、その置換基としてはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基などのアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基などのアルコキシ基が例示できる。

【0023】一般式(I)で表されるアミノ化合物は、特定の原料物質を用い公知の化学反応を利用して製造することが可能である。例えば、下記一般式(IV)で表わされるハロゲン化合物;

【化26】

$$A \leftarrow A r^{1} - X$$

(式中、A、A r 1 、n は上記と同意義; X はハロゲン原子を表わす)と下記一般式 (V) で表されるアミノ化合物;

【化27】

$$HN = \frac{R^1}{R^2}$$
 (V)

(式中、 R^1 、 R^2 は前記と同意義)を反応させることによって製造することができる。

【0024】上記一般式(IV)で表されるハロゲン化化合物の製造例としては、下記スキームで示されるように;

【化28】

下記一般式 (VI)で表わされるホルミル化アリール化合物:

【化29】

30

40

Ж

$$X - Ar5 - C - H$$

$$0$$
(VI)

(式中、Ar⁵は置換もしくは無置換のアリーレン基を表わし、Xはハロゲン原子を表わす)と下記一般式(IX)で表わされるアセチル化アリール化合物;

【化30】

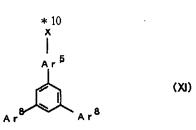
(式中、Ar⁸は置換もしくは無置換のアリール基を表 50 わす)を反応させて下記一般式(X)で表されるピリリ

ウム塩:

【化31】 (X)

1 1

(Y-は対イオンを表す)



(式中、Ar⁵、Ar⁸は前記と同意義)に転化させて得 ることができる。

【0025】なお、前記Ar5は、一般式(I)中のA r¹と同様の置換もしくは無置換のアリーレン基を表 し、Ar®は、一般式(II)中のAr²と同様の置換も しくは無置換のアリール基を表す。

【0026】また、同様な方法で、下記一般式(VI I)で表わされるホルミル化アリール化合物;

【化33】

(式中、Ar⁶は置換もしくは無置換のアリール基を表 わす)と下記一般式(VIII)で表わされるアセチル 化アリール化合物;

【化34】

$$X \longrightarrow Ar^7 \longrightarrow C \longrightarrow CH_3 \qquad (WI)$$

(式中、Ar7は置換もしくは無置換のアリーレン基を 表わし、Xはハロゲン原子を表わす)を反応させて下記 一般式(XII)ピリリウム塩;

【化35】

を得、前記ピリリウム塩を無水酢酸中、酢酸ナトリウム 存在下に加熱処理し、下記一般式(XIII)で表わさ※50

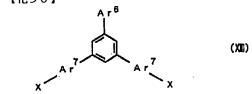
*を得た後、前記ピリリウム塩を無水酢酸中、酢酸ナトリ ウム存在下に加熱処理し、下記一般式(XI)で表わさ れるハロゲン化1,3,5-トリアリールベンゼン化合

【化32】

※れるハロゲン化1、3、5トリアリールベンゼン化合 物;

【化36】

20



(式中、Ar6、Ar7は上記と同意儀)に転化させるこ とによって得ることもできる。

【0027】なお、前記Ar6は、一般式(II)中の Ar³と同様の置換もしくは無置換のアリール基を表 30 し、Ar⁷は、一般式(I)中のAr¹と同様の置換もし くは無置換のアリーレン基を表す。

【0028】上記一般式 (XI) または (XIII) で 表されるハロゲン化1,3,5-トリアリールベンゼン化 合物と下記一般式(V)で表されるアミノ化合物; 【化37】

(V)

(式中、R¹、R²は一般式(I)中と同意義)を反応さ せることによって下記一般式(XIV)および(XV) 【化38】

$$R^{1-\frac{N}{R^2}} \stackrel{Ar^2}{\longrightarrow} Ar^{\frac{N}{R}} \stackrel{R^1}{\longrightarrow} (XV)$$

(Ar5~Ar8およびR1~R2は上記と同意義)で表さ れる化合物、すなわち一般式(I)で表されるアミノ化 合物を製造することができる。

【0029】上記アミノ化合物の合成は、塩基性化合物 または遷移金属化合物触媒と、溶媒との存在下、U11 mann反応により行うことができる。

【0030】上記アミノ化合物の合成に用いられる塩基 性化合物としては、アルカリ金属の水酸化物、炭酸塩、 炭酸水素塩、アルコラートなどが一般的であるが、第4 20 級アンモニウム化合物や脂肪族アミンや芳香族アミンの ような有機塩基を用いることも可能である。この中で、 アルカリ金属や第4級アンモニウムの炭酸塩や炭酸水素 塩が好ましいものとして用いられる。更に、反応速度、 および熱安定性という観点から、アルカリ金属の炭酸塩 や炭酸水素塩やアルコラートが最も好ましい。

【0031】合成に用いられる遷移金属、または遷移金 属化合物触媒としては、例えば、Cu、Fe、Ni、C r、V、Pd、Pt、Ag等の金属、およびそれらの化 合物が用いられるが、収率の点から、銅、パラジウム、30

またはそれらの化合物が好ましい。銅化合物としては特 に限定はなく、ほとんどの銅化合物が用いられるが、ヨ ウ化第一銅、塩化第一銅、酸化第一銅、臭化第一銅、シ アン化第一銅、硫酸第一銅、硫酸第二銅、塩化第二銅、 水酸化第二銅、酸化第二銅、臭化第二銅、リン酸第二 銅、硝酸第一銅、硝酸第二銅、炭酸銅、酢酸第一銅、酢 酸第二銅等が好ましい。その中でも、ヨウ化第一銅、塩 化第一銅、酸化第一銅、臭化第一銅、硫酸第一銅、硫酸 第二銅、塩化第二銅、酸化第二銅、臭化第二銅、酢酸第 10 一銅、酢酸第二銅は容易に入手可能である点で好適であ る。パラジウム化合物としても、ハロゲン化物、硫酸 塩、硝酸塩、有機酸塩などを用いることができる。遷移 金属、およびその化合物の使用量は、反応させるハロゲ ン化合物の0.5~500モル%である。

【0032】合成で用いられる溶媒は、一般的に用いら れ溶媒であればよいが、ジクロロベンゼン、ニトロベン ゼン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、 N-メチルピロリドン等の非プロトン性極性溶媒が好ま しく用いられる。

【0033】反応は、一般的には、常圧下100℃~2 50℃の温度範囲内で行われるが、加圧下で行っても差 し支えない。反応終了後、反応液中の固形分を除去した 後、溶媒を減圧留去して目的物を得ることができる。 【0034】上記アミノ化合物の具体例として、以下の ものが挙げられる。なお、これらの例示は、本発明のア ミノ化合物を制限的に提示しているものでも、またこれ らに限定する意図で開示しているものでもない。

[0035] 【化39】

[0036]

* *【化40】

[0037]

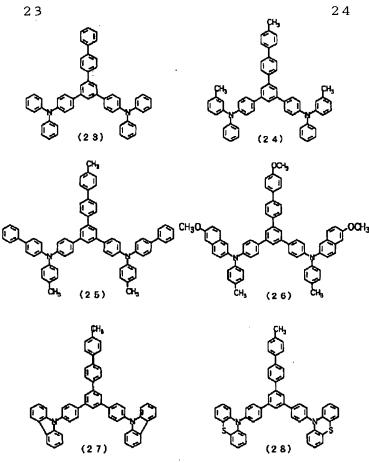
30【化41】

[0038]

*【化42】

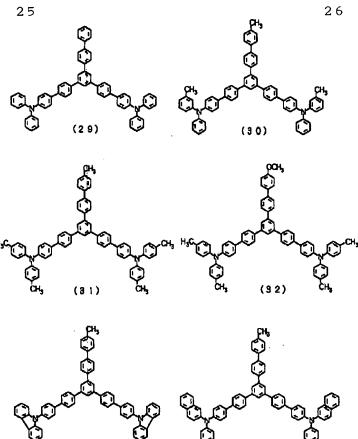
[0039]

* *【化43】



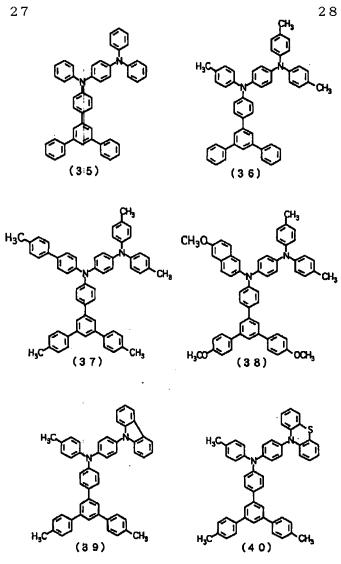
*【化44】

[0040]



[0041]

* *【化45】



[0042]

*【化46】

[0043]

* *【化47】

3 1 3 2 (50) (6 l) (52)

[0044]

*【化48】

[0045]

* *【化49】

【0046】 【化50】

[0048]

* *【化52】

*【化53】

[0049]

[0050]

*【化54】

【0051】一般式(I)で表わされるアミノ化合物は、電荷輸送機能、特に正孔輸送機能に優れており、かつ、耐久性、耐熱性に優れている。そのため、本発明の一般式(I)で表わされるアミノ化合物は電荷輸送材料としての用途に優れており、そのような機能を利用して種々の応用が考えられ、例えば感光体または有機エレクトロルミネッセンス素子の電荷輸送材料として、好適に使用することができる。

【0052】まず、一般式(I)で示されるアミノ化合 答性に優れた感光体を得ることが可能である。また、該物を電子写真感光体として用いる場合について説明す *50 化合物は、耐オゾン性、光安定性に優れているので、耐

* 3

【0053】一般式(I)で示されるアミノ化合物は、電子写真感光体のいずれの層においても使用できるが、高い電荷輸送特性を有することから電荷輸送材料として使用することが望ましい。

【0054】上記アミノ化合物は電荷輸送物質として作用し、光吸収により発生した、もしくは電極より注入した電荷を極めて効率よく輸送できるので、感度、高速応答性に優れた感光体を得ることが可能である。また、該化合物は、耐オゾン性、光安定性に優れているので、耐

久性に優れた感光体を得ることができる。

【0055】電子写真感光体としては、例えば、導電性支持体上に電荷発生材料と電荷輸送材料とを適当なバインダー樹脂に分散してなる単層型の感光層を形成してなる感光体、支持体上に感光層として電荷発生層と電荷輸送層とを積層してなる感光体、支持体上に下引層や導電層とを形成し、その上に感光層を形成してなる感光体、あるいは支持体上に下引層、感光層および表面保護層を順次積層してなる感光体が挙げられる。

【0056】支持体としては、銅、アルミニウム、鉄、 ニッケル、ステンレス等の箔、あるいは板やドラム形状 にしたものが使用される。また、これらの金属を紙やプ ラスチックドラム等に真空蒸着、無電解メッキしたも の、あるいは導電性ポリマー、酸化インジウム、酸化ス ズ等の導電性化合物の層を紙あるいはプラスチックドラ ム上に塗布もしくは蒸着によって設けたものも使用可能 である。一般的にはアルミニウムが使用され、例えば押 し出し加工後、引き抜き加工を施したアルミニウムパイ プを切断し、その外表面をダイヤモンドバイト等の切削 工具を用いて、約0.2~0.3mmに切削し仕上げたの 20 (切削管)や、アルミニウム円板を深絞り加工してカッ プ状とした後、外表面をしごき加工によって仕上げたも の(DI管)、アルミニウム円板をインパクト加工して カップ状とした後、外表面をしごき加工によって仕上げ たもの(EI管)、押し出し加工後、冷間引き抜き加工 したもの (ED管)等が挙げられる。また、これらの表 面をさらに切削したものを使用してもよい。

【0057】支持体上に下引層を形成する場合、支持体 表面を陽極酸化させて得られる酸化皮膜を下引層として 用いることがよく行われる。支持体がアルミ合金の場 合、アルマイト層を下引層として用いることが効果的で ある。また、適当な樹脂を溶解させた溶液や、その中に 低抵抗化合物を分散させ、この溶液や分散液を上記導電 性支持体上に塗布し、乾燥させることによっても形成さ れる。この場合、下引層に用いられる材料としては、ポ リイミド、ポリアミド、ニトロセルロース、ポリビニル ブチラール、ポリビニルアルコール等が適当で、これら の樹脂に低抵抗化合物を分散させてもよい。低抵抗化合 物としては、酸化錫、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ジル コニウム、フッ化マグネシウム等の金属化合物や有機顔 40 料、電子吸引性有機化合物、有機金属錯体等の有機化合 物が好適に用いられる。下引層の膜厚は、0.1~5μ m、好ましくは0. $2\sim3\mu$ m程度が望ましい。

【0058】上記支持体上または下引層上に感光層が形成されるが、以下、感光層として電荷発生層と電荷輸送 トルエン、キシレン、リグロイン、モノクロロベンゼ アルエン、キシレン、リグロイン、モノクロロベンゼ ン、ジクロロベンゼン等の芳香族類等の有機溶剤に分散するにあたっては、電荷発生材料を真空蒸着するか、散、あるいは溶解させて調製した感光塗液を、上記導電 地支持体上に塗布し、乾燥させて電荷発生層を設けるよ適当な溶剤もしくは必要があれば結着樹脂を溶解させた 溶液中に分散させて作製した塗布液を塗布乾燥して形成 50 に電荷輸送材料とバインダー樹脂を含有する電荷輸送層

する。接着性の点から見て、樹脂中に分散させたものが良好である。電荷発生層の膜厚は $0.01\sim2\mu$ m、好ましくは $0.05\sim1\mu$ m程度が望ましい。電荷発生層を形成するために使用されるバインダー樹脂は、電荷発生材料に対して100重量%以下が好ましいが、この限りではない。樹脂は2種類以上組み合わせて使用してもよい。

【0059】電荷発生層に用いる電荷発生材料としては、例えば、アゾ系顔料(ビスアゾ系顔料、トリスアゾ10系顔料を含む)、トリアリールメタン系染料、チアジン系染料、オキサジン系染料、キサンテン系染料、シアニン系色素、スチリル系色素、ピリリウム系染料、キナクリドン系顔料、インジゴ系顔料、ペリレン系顔料、多環キノン系顔料、ビスベンズイミダゾール系顔料、インダスロン系顔料、スクアリウム系顔料、フタロシアニン系顔料等の有機系顔料、および染料等が挙げられる。これ以外でも、光を吸収し極めて高い確率で電荷担体を発生する材料であれば、いずれの材料であっても使用することができるが、特にアゾ系(ビス系、トリス系)顔料や20フタロシアニン顔料が好ましい。

【0060】また、この電荷発生材料と共に使用する樹脂としては、例えば、飽和ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合体、イオン架橋オレフィン共重合体(アイオノマー)、スチレンーブタジエンブロック共重合体、ポリアリレート、ポリカーボネート、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、セルロースエステル、ポリイミド、スチロール樹脂、ポリアセタール樹脂、フェノキシ樹脂等の熱可塑性結着剤、エボキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、キシレン樹脂、アルキッド樹脂、熱硬化性アクリル樹脂等の熱硬化結着剤、光硬化性樹脂、ポリーNービニルカルバゾール、ポリビニルピレン、ボリビニルアントラセン等の光導電性樹脂を使用することができる。

【0061】上記の電荷発生材料をこれらの樹脂と共に、メタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン、シクロへキサノン等のケトン類、N,Nージメチルアセトアミド等のアミド類、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールモノメチルエーテル等のエーテル類、酢酸メチル、酢酸エチル等のエステル類、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、四塩化炭素、トリクロロエチレン等の脂肪族ハロゲン化炭化水素類、あるいはベンゼン、トルエン、キシレン、リグロイン、モノクロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の芳香族類等の有機溶剤に分散、あるいは溶解させて調製した感光塗液を、上記導電性支持体上に塗布し、乾燥させて電荷発生層を設けるよりにする。上記のようにして形成された電荷発生層の上に電荷輸送材料とバインダー物形を全有する電荷輸送層

を設ける。

【0062】バインダー樹脂としては、例えば、ポリカ ーボネート、ポリアリレート、飽和ポリエステル樹脂、 ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、エチレン-酢酸ビニル 共重合体、イオン架橋オレフィン共重合体(アイオノマ ー)、スチレンブタジエンブロック共重合体、ポリアリ レート、ポリカーボネート、塩化ビニルー酢酸ビニル共 重合体、セルロースエステル、ポリイミド、スチロール 樹脂、ポリアセタール樹脂、フェノキシ樹脂等の熱可塑 性結着剤、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン樹 10 送層中に、成膜性あるいは可撓性を向上させるための添 脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、キシレン樹脂、ア ルキッド樹脂、熱硬化性アクリル樹脂等の熱硬化結着 剤、光硬化性樹脂、ポリーN-ビニルカルバゾール、ポ リビニルピレン、ポリビニルアントラセン等の光導電性 樹脂を使用することができる。

【0063】感光体の電荷輸送層を形成するにあたって は、電荷輸送材料とバインダー樹脂とを適当な溶剤に溶 解させて得られる塗布溶液を、上記の電荷発生層の上に 塗布し、乾燥させる。電荷輸送層の膜厚は、5~60^μ m、好ましくは $10\sim50\mu$ m程度が望ましい。

【0064】また、電荷輸送層中の電荷輸送材料の含有 量は、その種類により一概には規定できないが、バイン ダー樹脂1重量部に対して概ね0.02~2重量部、好 ましくは0.5~1.2重量部添加することが望まし い。感光体に使用される電荷輸送材料は、一般式(I) で表わされる化合物を2種以上使用してもよいし、他の 電荷輸送材料と組み合わせて使用することもできる。

【0065】使用される他の電荷輸送材料としては、ヒ ドラゾン化合物、ピラゾリン化合物、スチリル化合物、 トリフェニルメタン化合物、オキサジアゾール化合物、 カルバゾール化合物、スチルベン化合物、エナミン化合 物、オキサゾール化合物、トリフェニルアミン化合物、 テトラフェニルベンジジン化合物、アジン化合物等の正 孔輸送材料や、フルオレノン化合物、アントラキノジメ タン化合物、ジフェノキノン化合物、スチルベンキノン 化合物、チオピランジオキシド化合物、オキサジアゾー ル化合物、ペルレンテトラカルボン酸化合物、フルオレ ニリデンメタン化合物、アントラキノン化合物、アント ロン化合物、シアノビニル化合物等の電子輸送材料等、 様々な化合物を使用することができる。

【0066】電荷輸送層の形成の際に使用する前記溶媒 としては、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、ク ロロベンゼン等のケトン、メタノール、エタノール、イ ソプロパノール等のアルコール、酢酸エチル、エチルセ ロソルブ等のエステル、四塩化炭素、四臭化炭素、クロ ロホルム、ジクロロメタン、テトラクロロエタン等のハ ロゲン化炭化水素、テトラヒドロフラン、ジオキサン等 のエーテル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ シド、ジエチルホルムアミド等を挙げることができる。 これらの溶媒は、1種単独で使用してもよく、あるい

は、2種以上を混合溶媒として併用してもよい。

【0067】上述したような積層型の感光層を形成する 場合、電荷輸送層、および電荷発生層の塗布は公知の方 法で各種の塗布装置を用いて行うことができる。具体的 には、浸漬コーティング法、スプレーコーティング法、 スピナーコーティング法、ブレードコーティング法、ロ ーラーコーティング法、ワイヤーバーコーティング法等 の色々なコーティング法を用いることができる。また、 上述したような積層型の感光層の場合には、特に電荷輸 加剤、残留電位の蓄積を抑制するための添加剤等、周知 の添加剤を含有させてもよい。

【0068】これらの具体的な化合物としては、ハロゲ ン化パラフィン、ポリ塩化ビフェニル、ジメチルナフタ レン、oーターフェニル、mーターフェニル、pーター フェニル、ジエチルビフェニル、水素化ターフェニル、 ジイソプロピルビフェニル、ベンジルビフェニル、ジイ ソプロピルナフタレン、ジベンゾフラン、9,10-ジ ヒドロキシフェナントレン等の可塑剤やクロラニル、テ 20 トラシアノキノジメタン、テトラシアノエチレン、トリ ニトロフルオレノン、ジシアノベンゾキノン、テトラク ロロ無水フタル酸、3,5-ジニトロ安息香酸、シアノ ビニル化合物等の電子吸引性増感剤、メチルバイオレッ ト、ローダミンB、シアニン染料、ピリリウム塩、チア ピリリウム塩等の増感剤が使用可能である。

【0069】可塑剤の添加量が多いほど、その層の内部 応力が低減されるため、感光層が電荷輸送層と電荷発生 層との積層により構成される場合には、電荷輸送層と電 荷発生層との間の接着性が、また、単層型の場合には感 30 光層と支持体間の接着性が改善される。しかし、多すぎ ると、機械的強度の低下や感度の低下等の問題が発生す るため、電荷輸送材料100重量部に対して1~100 重量部、好ましくは5~80重量部、より好ましくは1 0~50重量部程度添加することが望ましい。 増感剤の 添加量は、電荷輸送材料100重量部に対して0.01 ~20重量部、好ましくは0.1~10重量部、より好 ましくは0.5~8重量部程度添加することが望まし 11.

【0070】さらに、感光体の感光層、特に電荷輸送層 には、オゾン劣化防止の目的で酸化防止剤を添加しても よい。酸化防止剤としては、ヒンダードフェノール、ヒ ンダードアミン、パラフェニレンジアミン、ハイドロキ ノン、スピロクロマン、スピロインダノン、ヒドロキノ リンおよびこれらの誘導体や、有機燐化合物、有機硫黄 化合物等が挙げられる。

【0071】酸化防止剤の添加量は、多いほど接着性は 向上するものの、多すぎると機械的強度の低下や感度の 低下等の問題が発生し、少なすぎると酸化防止の充分な 効果が得られない。従って、電荷輸送材料100重量部 50 に対して0.1~50重量部、好ましくは1~30重量 部、より好ましくは3~20重量部程度添加することが望ましい。酸化防止剤と前記可塑剤とを併用する場合は、添加量の総量が1~120重量部、好ましくは5~100重量部、より好ましくは10~80重量部程度添加することが望ましい。可塑剤や酸化防止剤の溶解度が低い場合や融点が高い場合は、結晶析出を招いたり、それほど接着性が向上しなかったりするため、可塑剤や酸化防止剤の融点が100℃以下の化合物を用いることが好ましい。

【0072】感光体を構成する支持体と下引層の間に導 10 電層を設けてもよい。導電層としては、アルミニウム、鉄、ニッケル等の金属物を樹脂中に分散させたものや、 導電性の酸化スズ、酸化チタン、酸化アンチモン、酸化 ジルコニウム、ITO(インジウム、スズ酸化物固溶体)等の金属酸化物を樹脂中に分散させたものが好適に 用いられる。

【0073】さらに、感光層上に表面保護層を設けてもよい。表面保護層の膜厚は、5μm以下が望ましい。表面保護層に用いられる材料としては、アクリル樹脂、ポリアリール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ウレタン樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂などのポリマーをそのまま、または酸化スズ、酸化インジウム、などの低抵抗物質を分散させたものなどが使用可能である。また、表面保護層として、有機プラズマ重合膜を使用してもよい。有機プラズマ重合膜は必要に応じて適宜酸素、窒素、ハロゲン、周期律表の第3族、第5族原子を含んでもよい。

【0074】なお、単層型の感光層を形成する場合は、 電荷発生材料と電荷輸送材料とを、バインダー樹脂とと もに適当な樹脂に溶解した液を用いてディップコートや 30 スピンコートすることにより形成すればよい。

【0075】次に、一般式(I)で示される化合物を有機エレクトロルミネッセンス素子の材料として用いた場合について説明する。

【0076】図1〜図4に有機エレクトロルミネッセンス素子の実施形態を模式的に示した。図1中、(1)は陽極であり、その上に、有機正孔注入輸送層(2)と有機発光層(3)、および陰極(4)が順次積層された構成をとっており、該有機正孔注入輸送層には上記一般式(I)で表わされるアミノ化合物を含有する。

【0077】図2おいて、(1)は陽極であり、その上に、有機正孔注入輸送層(2)と有機発光層(3)、電子注入輸送層(5)および陰極(4)が順次積層された構成をとっており、該有機正孔注入輸送層または/および有機発光層に上記一般式(I)で表わされるアミノ化合物を含有する。

【0078】図3において、(1)は陽極であり、その 述しような導電性物質を用い、真上に、有機発光層(3)、有機電子注入輸送層(5)お グ等の手段や、ゾルーゲル法あるよび陰極(4)が順次積層された構成をとっており、該 て塗布する等の手段を用いて所望有機発光層に上記一般式(I)で表わされるアミノ化合 50 保されるように形成すればよい。

物を含有する。

【0079】図4おいて、(1)は陽極であり、その上に、有機発光層(3)および陰極(4)が順次積層された構成をとっており、該有機発光層に有機発光材料

(6)と電荷輸送材料(7)が含まれており、該電荷輸送材料に上記一般式(I)で表わされるアミノ化合物を使用する。

【0080】上記構成の有機エレクトロルミネッセンス 素子は、陽極(1)と陰極(4)がリード線(8)によ り接続され、陽極(1)と陰極(4)に電圧を印加する ことにより有機発光層(3)が発光する。

【0081】有機発光層、有機正孔注入輸送層、電子注入輸送層には、必要があれば公知の発光材料、発光補助材料、キャリア輸送を行う電荷輸送材料を使用することもできる。

【0082】一般式(I)で表わされる特定のアミノ化合物は、イオン化ポテンシャルが小さく、正孔輸送能が大きいため、有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させるために必要な発光開始電圧は低くてよく、そのた20 め安定して長時間の発光を可能ならしめていると考えられる。また、アミノ化合物を有機発光体として用いた場合にはアミノ化合物自体の発光材料としての機能と熱安定性が寄与しているものと考えられる。

【0083】有機エレクトロルミネッセンス素子の陽極(1)として使用される導電性物質としては4eVよりも大きい仕事関数をもつものがよく、炭素、アルミニウム、バナジウム、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、タングステン、銀、金、白金、およびそれらの合金や、酸化錫、酸化インジウム、酸化アンチモン、酸化亜鉛、酸化ジルコニウムなどの導電性金属化合物、さらにはポリチオフェンやポリピロール等の有機導電性樹脂が用いムカス

【0084】陰極(4)を形成する金属としては、4e Vよりも小さい仕事関数を持つものが好ましく、マグネシウム、カルシウム、錫、鉛、チタニウム、イットリウム、リチウム、ガドリニウム、イッテルビウム、ルテニウム、マンガン、およびそれらの合金が用いられる。陽極および陰極は、必要があれば2層以上の層構成により形成されてもよい。

0 【0085】有機エレクトロルミネッセンス素子においては、発光が見られるように、少なくとも陽極(1)あるいは陰極(4)のいずれか一方は透明電極にする必要がある。この際、陰極に透明電極を使用すると、透明性が損なわれやすいので、陽極を透明電極にすることが好ましい。

【0086】透明電極を形成する場合、透明基板上に前述しような導電性物質を用い、真空蒸着、スパッタリング等の手段や、ゾルーゲル法あるいは樹脂等に分散させて塗布する等の手段を用いて所望の透光性と導電性が確保されるように形成すればよい。

【0087】透明基板としては、適度の強度を有し、有機エレクトロルミネッセンス素子作製時、蒸着等による熱による悪影響を受けず透明なものであれば特に限定されないが、係るものを例示すると、ガラス基板や透明な樹脂、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエステル等を使用することも可能である。ガラス基板上に透明電極が形成されたものとしては、ITO、NESA等の市販品が知られているが、これらを使用してもよ

【0088】有機エレクトロルミネッセンス素子の作製例として、アミノ化合物を有機正孔注入輸送層に用いた場合の構成(図1)を用いて説明する。まず、上述した陽極(1)上に有機正孔注入輸送層(2)を形成する。有機正孔注入輸送層(2)は、前記した一般式(I)で表わされるアミノ化合物を蒸着して形成してもよいし、該アミノ化合物を溶解した溶液や、適当な樹脂と共に溶解した溶液をディップコートやスピンコートといった塗布法により形成してもよい。

11.

【0089】蒸着法で形成する場合、その膜厚は、通常 20 1~500nm程度であり、塗布法で形成する場合は5 ~1000nm程度に形成すればよい。形成する膜厚が 厚いほど、発光させるための印加電圧を高くする必要が あり、発光効率が悪く、有機エレクトロルミネッセンス 素子の劣化を招きやすい。また、膜厚が薄くなると、発 光効率はよくなるがブレイクダウンしやすなり、素子の 寿命が短くなる。

【0090】一般式(I)の化合物は、他の電荷輸送材料と併せて使用することができる。具体的には、フタロシアニン化合物、オルフィリ30ン化合物、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダゾール、イミダゾリン、イミダゾールチオン、ピラゾリン、ピラゾロン、テトラヒドロイミダゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、ヒラゾン、アシルヒドラゾン、ポリアリールアルカン、スチルベン、ブタジエン、ベンジジン型トリアリールアミン、ジアミン型トリアリールアミン等とそれらの誘導体、およびポリビニルカルバゾール、ポリシラン、導電性高分子等の高分子材料等が挙げられるが、その他にも、発光物質に対して優れた正孔注入効果を有し、発光層で生成した励起子の電子注40入層または電子輸送材料への移動を防止し、かつ薄膜形成能の優れた化合物等であれば使用できる。

【0091】上記有機正孔注入輸送層(2)上に、有機発光層を形成する。有機発光層に用いられる有機発光材料、発光補助材料としては、公知のものが使用可能で、例えば、エピドリジン、2,5ービス(5,7ージーtーペンチルー2ーベンゾオキサゾリル)チオフェン、2,2ー(1,4ーフェニレンジビニレン)ビスベンゾチアゾール、2,2ー(4,4ービフェニレン)ビスベンゾチアゾール、5-メチルー2ー/2-(4-/5-

54

メチルー2-ベンゾオキサゾリル)フェニル〕ビニル) ベンゾオキサゾール、2,5-ビス(5-メチルー2-ベンゾオキサゾリル)チオフェン、アントラセン、ナフ タレン、フェナントレン、ピレン、クリセン、ペリレ ン、ペリノン、1,4-ジフェニルブタジエン、テトラ フェニルブタジエン、クマリン、アクリジン、スチルベ ン、2-(4-ビフェニル)-6-フェニルベンゾオキ サゾール、アルミニウムトリスオキシン、マグネシウム ビスオキシン、ビス (ベンゾー8-キノリノール) 亜 10 鉛、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニ ウムオキサイド、インジウムトリスオキシン、アルミニ ウムトリス(5ーメチルオキシン)、リチウムオキシ ン、ガリウムトリスオキシン、カルシウムビス(5-ク ロロオキシン)、ポリ亜鉛ービス(8-ヒドロキシー5 ーキノリノリル) メタン、ジリチウムエピンドリジオ ン、亜鉛ビスオキシン、1,2-フタロペリノン、1, 2-ナフタロペリノン、トリス(8-ヒドキシキノリ ン)アルミニウム錯体などを挙げることができる。 【0092】また、一般的な蛍光染料、例えばクマリン

【0092】また、一般的な蛍光染料、例えばクマリン染料、ペリレン染料、ピラン染料、チオピラン染料、ポリメチン染料、メロシアニン染料、イミダゾール染料等も使用できる。これらのうち、特に好ましい材料としては、キレート化オキシノイド化合物が挙げられる。有機発光層は、前記した発光物質の単層構成でもよいし、発光色、発光強度等の特性を調整するために、多層構成としてもよい。また、2種以上の発光物質を混合したり、発光層にドープしてもよい。

【0093】有機発光層(3)は、上記のような発光物質を蒸着して形成してもよいし、該発光物質を溶解した溶液や適当な樹脂と共に溶解した液を、ディップコートやスピンコートといった塗布法にて形成してもよい。また、一般式(I)で表わされるアミノ化合物を発光物質として用いてもよい。

【0094】蒸着法で形成する場合、その膜厚は、通常 1~500nm程度、塗布法で形成する場合は、5~1 000nm程度に形成すればよい。形成する膜厚が厚い ほど発光させるための印加電圧を高くする必要があり、 発光効率が悪く、有機エレクトロルミネッセンス素子の 劣化を招きやすい。また、膜厚が薄くなると、発光効率 はよくなるがブレイクダウンしやすくなり、素子の寿命 が短くなる。

【0095】次に有機発光層(3)の上に、前記した陰極(4)を形成して有機エレクトロルミネッセンス素子とする。

【0096】図2に示したように、正孔注入輸送層

(2)、有機発光層(3)、および電子注入輸送層

様の手順で形成することができる。有機発光層も上述したのと同様の手順で形成することができ、アミノ化合物を発光物質として用いてもよい。アミノ化合物を発光物質として使用する場合は、他の発光物質を混合したり有機発光層にドープすることが好ましい。

【0097】電子注入輸送層は、電子輸送材料を用いて、正孔注入輸送層や有機発光層と同様に、蒸着法や塗布法等の従来公知の方法により形成することができる。【0098】電子輸送材料としては、例えば、フルオレノン、アントラキノジメタン、ジフェノキノン、スチル 10ベンキノン、チオピランジオキシド、オキサジアゾール、ペリレンテトラカルボン酸、フルオレニリデンメタン、アントラキノン、アントロン等とそれらの誘導体があるが、電子を輸送する能力を持ち、発光層または発光物質に対して優れた電子注入効果を有し、発光層で生成した励起子の正孔注入層または正孔輸送材料への移動を防止し、かつ薄膜形成能の優れた化合物であればこれらに限定されるものではない。また、電荷輸送材料に電子受容物質や電子供与性物質を添加することにより増感させることもできる。 20

【0099】図3に示したように、陽極(1)上に有機発光層(3)と電子注入輸送層(5)とを積層する場合、上述したのと同様の手順でアミノ化合物を用いて有機発光層を形成することができる。また、上述したのと同様にして電子注入輸送層を形成することができる。

【 0 1 0 0 】また、上記各構成において、正孔注入輸送 層は、正孔注入機能と正孔輸送機能を分離して、正孔注 入層と正孔輸送層の2層構成としてもよい。この場合、 正孔注入層に一般式 (I) で表わされる本発明のアミノ 化合物を使用することが好ましい。

【0101】正孔輸送層としては公知の正孔輸送材を使 用することができ、例えば、N,N'ージフェニルー $N, N' - \forall \lambda (3 - \lambda + \mu) - 1, 1' - \lambda'$ フェニルー4,4'ージアミン、N,N'ージフェニル -N, N'-ビス(4-メチルフェニル)-1, 1'-ジフェニルー4, 4'ージアミン、N, N'ージフェニ ル-N, N'-ビス(1-ナフチル)-1, 1'-ジフ ェニルー4, 4'ージアミン、N, N'ージフェニルー N, N'-ビス(2-ナフチル)-1, 1'-ジフェニ N-4, 4'-572, N, N'-572, (4-34)ルフェニル) -1, 1' -ジフェニル-4, 4' -ジア ミン、N, N'ーテトラ(4-メチルフェニル)-1. 1'-ビス(3-メチルフェニル)-4,4'-ジアミ ン、N, N' -ジフェニル-N, N' -ビス(3-メチ ルフェニル)-1,1'-ビス(3-メチルフェニル) -4, 4'-ジアミン、N, N'-ビス(N-カルバゾ リル) -1, 1' -ジフェニル-4, 4' -ジアミン、 4,4',4"-トリス(N-カルパゾリル)トリフェ ニルアミン、N, N', N"-トリフェニルーN, $N', N'' - h \cup J (3 - \lambda + \mu) \cup J = 1, 3,$

56

0 【0102】電子注入輸送層も、電子注入機能と電子輸送機能を分離して、電子注入層と電子輸送層の2層構成としてもよい。

【0103】図4に示したような単層構成の有機発光層 を形成するためには、有機発光材料と電荷輸送材料とを 共蒸着法により混合形成してもよいし、有機発光材料と 電荷輸送材料とを溶解した溶液や適当な樹脂とともに溶 解した液を用いてディップコートやスピンコートするこ とにより形成してもよい。電荷輸送材料としては上述し た電子輸送材料または正孔輸送材料が用いられ、これら 20 は混合して用いてもよいし、同じ輸送性の材料を2種以 上混合して用いてもよい。蒸着法で有機発光層を形成す る場合、その厚さは通常5~200 n mであり、塗布法 で形成する場合、10~500nm程度に形成すればよ い。塗布法の場合、混合して使用する樹脂としては、ボ リビニルカルバゾールやポリビニルアセチレンのような 光導電性樹脂を用いると特に良好な特性を得ることがで きる。以上、陽極(1)上に各層を形成する場合を例に とって説明したが、陰極(4)上に上述したのと同様の 手順で各層を形成しても構わない。

30 【0104】陰極と陽極とに二クロム線、金線、銅線、 白金線等の適当なリード線(8)を接続し、両電極に適 当な電圧(Vs)を印加することにより、有機エレクト ロルミネッセンス素子は発光する。

【0105】本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、各種の表示装置、あるいはディスプレイ装置等に適用可能である。以下に実施例を記載し、本発明を説明する。実施例中、「部」とあるは、特に断らない限り、「重量部」を表わす。

【0106】合成例1 (化合物(58)の合成)
40 水冷冷却管を設けた200mlの三つ口フラスコに、pートルアルデヒド5.0g(0.042mol)と4'ープロモアセトフェノン16.6g(0.083mol)を入れ、これにトルエン20mlを加えて溶解させた。次に、三フッ化ホウ素ージエチルエーテル錯体17.7g(0.125mol)をトルエン10mlに溶解し、この溶液を室温中攪拌しながら加えた後、8時間、加熱環流させた。反応液を室温まで冷却し、これに1,4ージオキサン200mlを加えて析出した結晶をろ過、減圧乾燥し、下記のピリリウム塩、13.7g(収率58%)を50 黄色結晶として得た。

【化55】

57

ピリリウム塩8. 0g(0.014mol)、酢酸ナトリ ウム2.3g(0.028mol)を入れ、これに無水 酢酸25mlを加えた後、10時間加熱還流させた。反応 液を室温まで冷却し、これに水およびジクロロメタンを 加えて生成物を有機層に抽出後、溶媒を減圧留去し、得 られた反応混合物について、シリカゲルカラムクロマト グラフィー (展開溶媒: ヘキサン/トルエン=1/1 (vol/vol))により精製し、下記ブロモ化トリフェニ ルベンゼン誘導体3.2g(収率48%)を薄茶色針状 結晶として得た。

【化56】

【0108】続いて、100mlの三つ口フラスコに、 上記プロモ化トリフェニルベンゼン誘導体1.5g (0.003 mol)、下記ベンジジン誘導体; 【化57】

2. 7g(0.006mol)、ナトリウムーtーブト |キシドロ: 75g(0. 0078mol)、酢酸パラジウ ム0.04g(0.00017mol)、トリーセーブチ ルホスフィンO. 14g(0.00067mol)を入 れ、これに溶媒としてoーキシレン15mlを加えた後、 窒素雰囲気下、120℃で3時間攪拌した。溶液を室温 まで冷却し、ジクロロメタン100mlを加えて内容物を 溶解させ、不溶物をろ別した後、残渣の溶媒を減圧留去 した。得られた反応混合物について、シリカゲルカラム クロマトグラフィー (展開溶媒: ヘキサン/トルエン= 1/1 (vol/vol)) により精製し、目的化合物(5 8)3.1g(収率83%)を淡黄色結晶として得た。 【0109】得られた化合物の融点は167~169℃ 50

であった。また、分子式の分析を行ったところ、以下の 結果を得た。なお、分子式の分析はCHN分析装置を用 いて行った。以下の合成例についても同様である。

分子式: C87 H68 N4

計算値(%) C:89.35% H:5.86%

N:4.79%

分析値(%) C:89.29% H:5.90% N:4.81%

【0110】合成例2 (化合物(57)の合成) 【0107】次に、100mlの三つ口フラスコに、上記 10 合成例1において、4'ーブロモアセトフェノンの替わ りに4'-ヨードアセトフェノンを用い、同様の操作に て目的化合物(57)を合成した。水冷冷却管を設けた 200mlの三つ口フラスコに、p-トルアルデヒド5. Og(0.042mol)と4'-ヨードアセトフェノン 20. 4g(0.083mol)を入れ、これにトルエン 20mlを加えて溶解させた。次に、三フッ化ホウ素ージ エチルエーテル錯体17.7g(0.125mol)をト ルエン10mlに溶解し、この溶液を室温中攪拌しながら 加えた後、8時間、加熱環流させた。反応液を室温まで 20 冷却し、これに1, 4 - ジオキサン200mlを加えて析 出した結晶をろ過、減圧乾燥し、下記のピリリウム塩、 14.5g(収率52%)を黄色結晶として得た。

【化58】

30

【0111】次に、100mlの三つ口フラスコに、上記 ピリリウム塩9.3g(0.014mol)、酢酸ナトリ ウム2.3g(0.028mol)を入れ、これに無水 酢酸25mlを加えた後、10時間加熱還流させた。反応 液を室温まで冷却し、これに水およびジクロロメタンを 加えて生成物を有機層に抽出後、溶媒を減圧留去し、得 られた反応混合物について、シリカゲルカラムクロマト グラフィー (展開溶媒:ヘキサン/トルエン=1/1 (vol/vol))により精製し、下記ヨード化トリフェニ ルベンゼン誘導体3.7g(収率49%)を薄茶色針状 結晶として得た。

【化59】

【0112】続いて、100mlの三つ口フラスコに、 上記ヨード化トリフェニルベンゼン誘導体1.7g (0.003mol)、下記ベンジジン誘導体; 【化60】

2.7g(0.006mol)、ナトリウムーtーブト 10 キシドO. 75g(O. 0078mol)、酢酸パラジウ ム0.04g(0.00017mol)、トリーセープチ ルホスフィン0.14g(0.00067mol)を入 れ、これに溶媒としてoーキシレン15mlを加えた後、*

* 窒素雰囲気下、120℃で3時間攪拌した。溶液を室温 まで冷却し、ジクロロメタン100mlを加えて内容物を 溶解させ、不溶物をろ別した後、残渣の溶媒を減圧留去 した。得られた反応混合物について、シリカゲルカラム クロマトグラフィー (展開溶媒: ヘキサン/トルエン= 1/1 (vol/vol)) により精製し、目的化合物(5 7)3.1g(収率83%)を淡黄色結晶として得た。 【0113】得られた化合物についての分析結果は、合 成例1と同様であった。

【0114】電子写真感光体の電荷輸送材料への応用 実施例1

下記構造式で表わされるトリスアゾ化合物 【化61】

0.45部、ポリエステル樹脂(バイロン200:東洋 20%Vでコロナ帯電させ、初期表面電位 V_0 (V)、初期電 紡績社製) 0.45部をシクロヘキサノン50部ととも にサンドミルにより分散させた。得られたトリスアゾ化 合物の分散物を80々のアルミドラム上に浸漬塗布法に より、乾燥膜厚が O. 3g/m²となるように塗布した 後、これを乾燥させた。このようにして得られた電荷発 生層の上にアミノ化合物(2)50部およびポリカーボ ネート樹脂(パンライトK-1300;帝人化成社製) 50部を1,4-ジオキサン400部に溶解した溶液 を、乾燥膜厚が20μmになるように塗布し、乾燥させ て電荷輸送層を形成した。このようにして、2層からな 30 る感光層を有する電子写真感光体が得られた。

【0115】こうして得られた感光体を市販の電子写真 複写機(ミノルタ社製: EP-540)を用い、-6K※

位を1/2にするために要した露光量 $E_{1/2}$ ($1 u x \cdot$ sec)、1秒間暗所中に放置したときの初期電位の減 衰率DDR1(%)を測定した。

【0116】実施例2~4

実施例1と同様の方法、同一の構成で、実施例1で用い たアミノ化合物(2)の代わりにアミノ化合物(6)、 (7)、(8)を用いた感光体を作製した。こうして得 られた感光体について、実施例1と同様の方法で、 Vo、E1/2、DDR1を測定した。

【0117】実施例5 下記構造式で表わされるビスアゾ化合物 【化62】

0.45部、ポリスチレン樹脂(分子量40,000) 0.45部をシクロヘキサノン50部とともにサンドミ ルにより分散させた。得られたビスアゾ化合物の分散物 を80 φのアルミドラム上に浸漬塗布法により、乾燥膜 厚がO.3g/m²となるように塗布した後、これを乾 燥させた。

【0118】このようにして得られた電荷発生層の上に アミノ化合物(13)50部および、ポリアリレート樹 脂(U-100;ユニチカ社製)50部を1,4-ジオ キサン400部に溶解した溶液を、乾燥膜厚が25µm になるように塗布し、乾燥させて電荷輸送層を形成し た。このようにして、2層からなる感光層を有する電子 写真感光体が得られた。

★【0119】実施例6~8

実施例5と同様の方法、同一の構成で、実施例5で用い たアミノ化合物(13)の代わりにアミノ化合物(1 4)、(17)、(20)を用いた感光体を作製した。 こうして得られた感光体について、実施例1と同様の方 法で、Vo、E1/2、DDR1を測定した。

【0120】実施例9

下記構造式で表わされる多環キノン系顔料 【化63】

★50

0.45部、ポリカーボネート樹脂(パンライトK-1 3000: 帝人化成社製) 0.45部をジクロロエタン 50部とともにサンドミルにより分散させ、得られた多 環キノン系顔料の分散物を80々のアルミドラム上に、 乾燥膜厚が0.4g/m²となるように塗布した後、乾 燥させた。このようにして得られた電荷発生層の上にア ミノ化合物(25)60部、およびポリアリレート樹脂 (U-100:ユニチカ社製)50部を1,4-ジオキ サン400部に溶解した溶液乾燥膜厚が18μmになる ように塗布し、乾燥させて電荷輸送層を形成した。この ようにして、2層からなる感光層を有する電子写真感光 体を作製した。

【0121】実施例10~11

実施例9と同様の方法で同一の構成のもの、但し実施例 9で用いたアミノ化合物(25)の代わりに、アミノ化 20 合物(26)、(33)を各々用いる感光体を作製し た。こうして得られた感光体について、実施例1と同様 の方法で、Vo、E_{1/2}、DDR₁を測定した。

【0122】実施例12

チタニルフタロシアニン0.45部、ブチラール樹脂 (BX−1:積水化学工業社製)0.45部をジクロロ エタン50部とともにサンドミルにより分散させ、得ら れたフタロシアニン顔料の分散物を80ヶのアルミドラ ム上に、乾燥膜厚がO.3μmとなるように塗布した 後、乾燥させた。このようにして得られた電荷発生層の 30 上に、アミノ化合物(35)50部、およびポリカーボ ネート樹脂(PC-Z:三菱ガス化学社製)50部を 1.4-ジオキサン400部に溶解した溶液を乾燥膜厚 が18μmになるように塗布し、乾燥させて電荷輸送層 を形成した。このようにして、2層からなる感光層を有 する電子写真感光体を作製した。こうして得られた感光 体について、実施例1と同様の方法で、Vo、E1/2、D RRIを測定した。

【0123】実施例13

銅フタロシアニン50部とテトラニトロ銅フタロシアニ 40 ンロ、2部を98%濃硫酸500部に充分攪拌しながら 溶解させ、これを水5000部にあけ、銅フタロシアニ ンとテトラニトロ銅フタロシアニンの光導電性材料組成 物を析出させた後、ろ過、水洗し、減圧下120℃で乾 燥した。こうして得られた光導電性組成物10部を熱硬 化性アクリル樹脂(アクリデュクA405:大日本イン ク社製)22.5部、メラミン樹脂(スーパーベッカミ ンJ820:大日本インク社製)7.5部、アミノ化合 物(43)15部をメチメエチルケトンとキシレンを同

に入れて48時間分散して感光性塗液を調製し、この塗 液を80々のアルミドラム上にスプレー塗布し、乾燥し て約15μmの感光層を形成させた。このようにして、 単層型感光体を作製した。こうして得られた感光体につ いて、実施例1と同様の方法、但しコロナ帯電を+6K Vで行い、Vo、E1/2、DDR1を測定した。

【0124】実施例14~15

実施例13と同様の方法で同一の構成のもの、但し実施 例13で用いたアミノ化合物(43)の代わりにアミノ 10 化合物(44)、(49)を各々用いる感光体を作製し た。こうして得られた感光体について、実施例13と同 様の方法で、Vo、E1/2、DDR1を測定した。実施例 1~15で得られた感光体のVo、E1/2、DDR1の測 定結果を表1にまとめて示す。

[0125]

【表1】

	v. (V)	E 1/2 (Lux · sec)	DDR , (96)
実施例	-650	1. 0	2. 8
実施例2	-660	1. 0	2. 9
実施例 8	-650	1. 0	2. 9
実施例4	-660	0. 9	3. 1
実施例 5	-660	0.8	2. 7
実施例 6	-660	1. 0	3. 0
実施例7	-670	0. 7	3. 2
実施例8	-660	0.8	2. 9
実施例 9	-660	1. 0	3. 2
実施例 10	-650	0.8	2. 9
実施例 11	-650	0. 9	2. 7
実施例 12	-650	0. 9	3. 1
実施例 13	+660	0. 9	2. 8
実施例 14	+660	0.8	3. 1
実施例 15	+650	0. 9	2. 8

【0126】表1からわかるように、本実施例の感光体 は積層型でも単層型でも電荷保持能が充分あり、暗減衰 率も感光体としては充分使用可能な程度に小さく、ま た、感度においても優れている。さらに、市販の電子写 真複写機(ミノルタ社製; EP-350Z)による正帯 電時の繰り返し実写テストを実施例15の感光体におい て行ったが、1,000枚のコピーを行っても、初期と 最終画像において階調性が優れ、感度変化がなく、鮮明 な画像が得られた。このことから、本発明の感光体は繰 り返し特性も安定していることがわかる。

【0127】有機エレクトロルミネッセンス素子への応

実施例16

インジウム-スズ酸化物被覆ガラスの基板上に、有機正 孔注入輸送層としてアミノ化合物(10)を蒸着により 厚さ50nmの薄膜を形成した。次に、有機発光層とし 量混合した混合溶剤100部とともにボールミルポット 50 て、アルミニウムトリスオキシンを蒸着により50nm

の厚さになるように薄膜を形成した。さらに、陰極とし て、マグネシウムを蒸着により200nmの厚さになる ように薄膜を形成した。以上のようにして、有機エレク トロルミネッセンス素子を作製した。

【0128】実施例17~19

実施例16において、アミノ化合物(10)を使用する 代わりに、アミノ化合物(13)、(18)、(20) に代えること以外は実施例16と全く同様にして、有機 エレクトロルミネッセンス素子を作製した。

【0129】実施例20

インジウムースズ酸化物被覆ガラスの基板上に有機正孔 注入輸送層としてアミノ化合物(25)を蒸着により7 0 n m の 厚さになるように薄膜を形成した。次に、有機 発光層としてアルミニウムトリスオキシンを100nm の厚さになるように薄膜を形成した。次に、有機電子注 入輸送層として、下記のオキサジアゾール化合物;

【化64】

を蒸着により50 n mの厚さになるように薄膜を形成し た。さらに、陰極として、マグネシウムを蒸着により2 00 n mの厚さになるように薄膜を形成した。以上のよ うにして、有機エレクトロルミネッセンス素子を作製し

【0130】実施例21~23

実施例20において、化合物(25)を使用する代わり に、アミノ化合物(30)、(38)、(46)を使用 すること以外は実施例20と全く同様にして有機エレク トロルミネッセンス素子を作製した。

【0131】実施例24

インジウムースズ酸化物被覆ガラスの基板上に、有機発 光層としてアミノ化合物(48)を蒸着により50nm の厚さで薄膜を形成した。次に、有機電子注入輸送層と して下記のオキサジアゾール化合物:

【化65】

を蒸着により20 nmの厚さになるように薄膜を形成し た。さらに、陰極として10:1の原子比でMgおよび Agを蒸着により20nmになるように薄膜を形成し た。以上のようにして、有機エレクトロルミネッセンス 素子を作製した。

【0132】実施例25

インジウムースズ酸化物被覆ガラス基板上に、化合物 (50)を真空蒸着して膜厚20nmの正孔注入層を形 成した。次に、N, N'ージフェニル-N, N'-(3 ーメチルフェニル)-1,1'-ビフェニル-4,4' -ジアミンを真空蒸着して、膜厚40nmの正孔輸送層 を形成した。次に、トリス(8-ヒドロキシキノリン) アルミニウム錯体を蒸着により50 nmの厚さになるよ 50 64

うに薄膜を形成した。さらに、陰極として10:1の原 子比でMgおよびAgを蒸着により200nmの厚さに なるように薄膜を形成した。以上のようにして、有機工 レクトロルミネッセンス素子を作製した。

【0133】実施例26

インジウム-スズ酸化被覆ガラス基板上に、N,N'-ジフェニル-N, N'-(3-メチルフェニル)-1, 1'ービフェニルー4,4'ージアミンを真空蒸着し て、膜厚60nmの正孔注入輸送層を形成した。次に、 10 トリス(8-ヒドロキシキリン)アルミニウム錯体とア ミノ化合物(53)を3:1の割合で真空蒸着により6 Onmの厚さになるように発光層を形成した。さらに、 陰極として10:1の原子比でMgおよびAgを蒸着に より200 nmの厚さになるように薄膜を形成した。以 上のようにして、有機エレクトロルミネッセンス素子を 作製した。

【0134】実施例27

インジウムースズ酸化物被覆ガラス基板上に化合物(5 5) をジクロロメタンに溶解させ、スピンコーティング 20 により膜厚50 n mの正孔注入輸送層を得た。さらに、 トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム錯体を 蒸着により20nmの厚さになるように発光層を形成し た後、下記オキサジアゾール化合物;

【化66】

を蒸着により膜厚20nmの電子注入輸送層を形成し た。さらに、陰極として10:1の原子比でMgおよび Agを蒸着により200nmの厚さになるように薄膜を 30 形成した。以上のようにして、有機エレクトロルミネッ センス素子を作製した。

【0135】実施例28~29

実施例27において、化合物(55)を使用する代わり に、アミノ化合物(57)、(58)を使用すること以 外は実施例27と全く同様にして、有機エレクトロルミ ネッセンス素子を作製した。

【0136】実施例30

インジウムースズ酸化物被覆ガラス基板上に、化合物 (62)、トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニ 40 ウム錯体、ポリメチルメタクリレートを3:2:5の重 量比率でテトラヒドロフランに溶解させ、スピンコーテ ィング法により膜厚100mmの発光層を形成した。次 に、陰極として10:1の原子比でMgおよびAgを蒸 着により200nmの厚さなるように薄膜を形成した。 以上のようにして、有機エレクトロルミネッセンス素子 を作製した。

【0137】比較例1

インジウムースズ酸化物被覆ガラス基板上に有機正孔注 入輸送層として下記アミノ化合物;

【化67】

を真空蒸着により、厚さ50 nmの薄膜を形成した。次 に、有機発光層として、アルミニウムトリスオキシンを 真空蒸着により厚さ50 nmになるように薄膜を形成し た。以上のようにして、有機エレクトロルミネッセンス 素子を作製した。

*【0138】評価

実施例16~30および比較例1で得られた有機エレク トロルミネッセンス素子について、そのガラス電極を陽 極として直流電圧をかけた時の発光開始電圧、および最 高発光輝度とその時の発光開始電圧を測定した。測定結 果を表2にまとめて示す。

[0139] 【表2】

		*		
	発光開始電圧	最高発光輝		
	(V)	(od/m		
- 1		,,		

	発光開始電圧	最高発光輝度	最高発光輝度に
	(V)	(od/m²)	おける電圧(V)
実施例 16	3. 6	16000	11.9
実施例 17	3. 9	15800	12.0
実施例 18	3. 3	16500	11.9
実施例 19	3. 7	14300	11.9
実施例 20	3. 5	15700	12.2
実施例 21	3. 4	18800	11.9
実施例 22	3. 5	15600	12.5
実施例 23	3. 2	16900	12.3
実施例 24	3. 7	14600	1 2. 1
実施例 25	3. 4	15100	12.0
実施例 26	3. 7	18300	12.1
実施例 27	3. 1	14600	11.9
実施例 28	3. 3	17800	12.1
実施例 29	3. 4	16200	12.0
実施例 30	3.5	15400	12.5
比較例1	4. 5	8700	12.1

【0140】表2からわかるように、本発明の有機エレ クトロルミネッセンス素子は低電圧でも高い発光輝度を 30 トロルミネッセンス素子を得ることができる。 示した。また、本発明の実施例21の有機エレクトロル ミネッセンス素子について、電流密度1mA/cm2で 連続発光させたところ、1000時間以上安定な発光を 観測することができた。本発明の有機エレクトロルミネ ッセンス素子は、発光効率、発光輝度の向上と素子の長 寿命化を達成すものであり、併せて使用される発光材 料、発光補助材料、電荷輸送材料、增感剤、樹脂、電極 材料等の素子構成材料、および素子作製方法に限定され るものではない。

[0141]

【発明の効果】本発明は、優れた電荷輸送能力を有する 新規なアミノ化合物を提供する。該アミノ化合物を使用 することにより、感度、電荷輸送特性、初期表面電位、 暗滅衰率等の初期電子写真特性に優れ、繰り返し使用に 対する疲労も少ない電子写真感光体、および発光強度が※

※大きく発光開始電圧が低い、耐久性に優れた有機エレク

【図面の簡単な説明】

【図1】 有機エレクトロルミネッセンス素子の一構成 例の概略断面図。

【図2】 有機エレクトロルミネッセンス素子の一構成 例の概略断面図。

【図3】 有機エレクトロルミネッセンス素子の一構成 例の概略断面図。

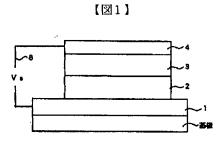
【図4】 有機エレクトロルミネッセンス素子の一構成 例の概略断面図。

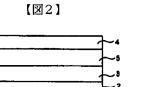
40 【符号の説明】

2:正孔注入輸送層 1:陽極

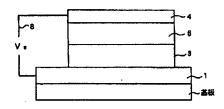
3:有機発光層、 4:陰極

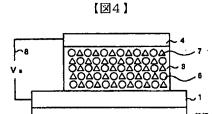
5:電子注入輸送層 6:有機発光材料 7:電荷輸送材料 8:リード線





【図3】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C O 7 D 471/06		CO7D 471/06	4 C 2 O 4
C O 9 K 11/06	620	C O 9 K 11/06	620 4H006
	655		655
G O 3 G 5/06	312	G03G 5/06	312
H O 5 B 33/14		H O 5 B 33/14	A
33/22		33/22	D

(72)発明者 古川 慶一

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル ミノルタ株式会社内 Fターム(参考) 2H068 AA20 AA21 BA12 BA14 BA16

3K007 AB02 AB06 AB11 CA01 CB01

DA01 DB03 EB00

4C036 AA02 AA11 AA12 AA14 AA17

AA18

4C056 AA01 AB02 AC07 AD01 AE03

AF05 FA04 FB01 FC01

4C065 AA07 AA18 BB06 CC09 DD02

EE02 HH01 JJ04 KK01 LL03

PP08 PP16

4C204 BB05 BB09 CB25 DB01 EB01

FB08 FB16 GB01

4H006 AA01 AA02 AB76 AC28 AC52

BA02 BA32 BB17 BC10